

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 12 日 (12.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/043247 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G03F 7/039, 7/022 (74) 代理人: 鐘尾 宏紀, 外(KANAO, Hiroki et al.); 〒1010063 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 10 番 14 号 ぱんだいビル 2 階 むつみ国際特許事務所 千代田オフィス Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/013354
- (22) 国際出願日: 2004 年 9 月 14 日 (14.09.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-373069
2003 年 10 月 31 日 (31.10.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): AZ エレクトロニックマテリアルズ株式会社 (AZ ELECTRONIC MATERIALS (JAPAN) K.K.) [JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込二丁目 2 番 8 号 文京グリーンコート Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 牧井 利道 (MAKII, Toshimichi) [JP/JP]; 〒4371496 静岡県小笠郡大東町千浜 3810 クラリアントジャパン株式会社内 Shizuoka (JP). 西脇 良典 (NISHIWAKI, Yoshinori) [JP/JP]; 〒4210301 静岡県榛原郡吉田町住吉 5402-8 メゾンプラージュ A202 Shizuoka (JP). 明石 一通 (AKASHI, Kazumichi) [JP/JP]; 〒4371496 静岡県小笠郡大東町千浜 3810 クラリアントジャパン株式会社内 Shizuoka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: THICK FILM OR ULTRATHICK FILM RESPONSIVE CHEMICAL AMPLIFICATION TYPE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: 厚膜および超厚膜対応化学増幅型感光性樹脂組成物

(57) Abstract: A chemical amplification type photosensitive resin composition comprising an alkali soluble novolak resin (A), a resin or compound which itself is insoluble or hardly soluble in an alkali but becomes soluble in an alkali by the action of an acid (B), an acid generator (C) and a photosensitive agent having a quinonediazido group (D) optionally together with an alkali soluble acrylic resin (E) and a crosslinking agent for film quality improvement (F). This chemical amplification type photosensitive resin composition is a thick film or ultrathick film responsive photosensitive resin composition and is preferably used as a resist for forming a bump for use as a magnetic pole of magnetic head or a terminal for LSI connection.

(57) 要約: (A) アルカリ可溶性ノボラック樹脂、(B) それ自身はアルカリに不溶または難溶であるが、酸の作用によりアルカリに可溶となる樹脂または化合物、(C) 酸発生剤、(D) キノンジアジド基を含む感光剤、および必要に応じて (E) アルカリ可溶性アクリル系樹脂および (F) 膜質改善のための架橋剤を含有する化学増幅型感光性樹脂組成物。この化学増幅型感光性樹脂組成物は、厚膜並びに超厚膜対応感光性樹脂組成物であり、磁気ヘッドの磁極や LSI の接続用端子として用いられるバンプを形成する際のレジストとして好ましく用いられる。

WO 2005/043247 A1